سیویلیکا - ناشر تخصصی مقالات کنفرانس ها و ژورنال ها
گواهی ثبت مقاله در سیویلیکا
CIVILICA.com

عنوان مقاله:
تاثیر تابکاری بر روی لایو نازک اکسید تنگستن بو منظور کاربرد در سیستم آینوی گرمایی

محل انتشار:
بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران (سال: 1392)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:
قاسم کاوه ای - *کرج مشکین دشت پژوهشگاه موادوانرژی*

آیدین های فکور - *پژوهشگاه موادوانرژی پژوهشکده نیمه هادی ها*

سعید نیک بین - *پژوهشگاه موادوانرژی پژوهشکده نیمه هادی ها*

خلاصه مقاله:
سیستم سه لایه ی دی الکتریک/فلز/دی الکتریک لایه نشانی شده بر روی شیشه، میتواند به عنوان یک فیلتر اپتیکی که طیف مادون قرمز امواج الکترومغناطیس را بازتاب و به بیشتر امواج مریی اجازه ی عبور میدهد به کار رود. دراین تحقیق از اکسیدتنگستن به عنوان دیالکتریک و از نقره برای پوشش فلزی بازتاب دهنده استفاده شد. لایه ی نازک اکسید تنگستن با استفاده از تکنیک تبخیر با پرتو الکترونی لایه نشانی شد. اثر دما و مدت تابکاری بر روی ساختار و خواص اپتیکی لایه ها بررسی شد. تابکاری در خلا و در دماهای مختلف انجام شد. مورفولوژی سطح با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی مورد بررسی قرار گرفت که نشان داد که اندازه ی مولکولها وابسته به دمای تابکاری میباشد.

کلمات کلیدی:

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

https://civilica.com/doc/746592